

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

優先権主張	出願番号
フランス国 1971 年 1 月 4 日	7100274
国 年 月 日	
国 年 月 日	
国 年 月 日	

第 号

(2000円)

特 許

優先権主張
昭和 47 年 1 月 5 日

特許庁長官殿

1. 発明の名称
プラスチックを太陽輻射線による光劣化から
保護する方法

2. 発明者
住所
氏名
ベルギー、ブラッセル市、リニ・レイモンド、
614
ジャン・シヨ・フォーレオ・クヌ

3. 特許出願人
住所
名称
ベルギー、ブラッセル市、ルウ・プリンス、
アルベルト、331
ソルグエイ・アンド・コムパニイ

インリイ・デ・ル・ル

4. 代理人
住所
氏名
〒105 東京都港区西新橋1丁目2番9号
三井物産館内 電話(591)0261番
(2400) 氏名 金 丸 義 男 外 5 名

47 60

明 細 書

1. 発明の名称

プラスチックを太陽輻射線による光劣化から
保護する方法

2. 特許請求の範囲

保護されるべき物品の表面に蒸気状の紫外線吸
収剤を含有する塗膜を作用させることを特徴と
するプラスチックを太陽輻射線による光劣化から
保護する方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はプラスチック物品を太陽輻射線による
光劣化から保護する方法に関する。

短波長の太陽輻射線が戸外の使用において塩化
ビニルホモポリマーおよび共重合体、アクリロニ
トリル-ブタジエン-スチレン共重合体、ポリオ
レフィン、ポリカーボネート、ポリステレンなど
のごときプラスチックは多かれ少かれ急激な光劣
化を生ずることは周知である。この光劣化は機械
的性質特に耐衝撃性の低下および時々露光せられ
る物品の脱色と不透明化を惹起する。

1

② 特願昭 47-60

⑪ 特開昭 47-13678

④ 公開昭 47.(1972) 7.17 (全 5 頁)

審査請求 無

⑬ 日本国特許庁

⑬ 公開特許公報

庁内整理番号

⑤ 日本分類

6677 47

2700K111



方式 登録

従つて樹脂中にその加工時に紫外線吸収剤を配
合することが提案せられており、最も周知の紫外
線吸収剤はベンゾフェノンおよびベンゾトリアゾ
ール誘導体である。更にこの処理は樹脂中に酸
化防止剤およびフリーラジカルの形成を阻止する
製品も配合することにより改善される。

さらに、露光せられる物品の表面層は多量の有
害な紫外線を吸収するので、プラスチックの劣化
を促進する太陽輻射線の露光は非常に弱いことが
認められた。

紫外線吸収剤が蒸気であることおよび光劣化が
露光される物品の表面で起ることを考慮して、樹
脂中に紫外線吸収剤の蒸気のない分散より保護
せらるべき物品の表面層において紫外線吸収剤を
塗布する方法を行うことが試みられている。

この必要性を満すのに非常に適当な方法は保護
されるべき物品を紫外線吸収剤を含有するワニス
で保護することからなる。しかしながら、この方
法は保護せられるべき材料の性質に応じて種々の
ワニスを製造することを必要とし、作業の問題を生

2

ずる。一般に、ある時間の経過後にワニスは保護せられた材料から剝離する傾向があることが認められている。

他の周知の方法によれば、紫外線吸収剤は保護せられるべき物品の表面に物品を構成する樹脂に対し彫蝕作用を有する溶剤中の紫外線吸収剤の溶液に浸漬するかまたは溶剤液から蒸発する技術により適用される。

従つてこの方法は溶剤を回収するために比較的高価で場所をとる機械の使用を要する。更に、溶剤の抽出を完全にやりこすことは困難であり、溶剤は処理中の物品の表面層に浸透し、その結果溶剤の残留痕跡は紫外線吸収剤の表面エフロレッセンス（表面吹出し）を促進する。また溶剤の彫蝕作用のため、処理される各樹脂により彫蝕に選択されなければならない溶剤と処理される物品の機械的性質に影響を与える。少くとも破壊技術は選択的な面々に与える彫蝕の保護のみが可能であり、これに対し受渡すに十分な形成と溶剤の抽出を生じこれらは処理される物品の表面の仕上りを

3

更に、この方法は比較的精巧に作られた輪郭を有する物品の処理に対しては行い難い。

少くとも、規則的に比較的薄い被膜を得るためには溶剤かまたは溶剤液の紫外線吸収剤を使用することが必要であるがこの場合欠点は前述した方法におけるものと同様である。

本発明者らはこゝに太陽光照射による劣化からプラスチック物品の表面を保護しかつ前述の欠点を示さない新規な方法を完成した。

本発明の方法は例へば溶剤を使用しないことを可能にしかつ完成物品あるいは半完成物品にその形状に拘束なく容易に適用し得る。

更に、本発明の方法は処理された物品の形状を成形し、あるいはその構成材料を劣化させることのある重大な熱処理を必要としない。

また本発明者らは本方法で処理された物品の機械的性質に影響を与えずかつ比較的短時間で紫外線吸収剤の重要な被膜を得ることを可能にすることを認めた。

少くとも、保護された材料の表面層中の紫外線

を低下させる。

これらの欠点を避けるために、結局のところ液体の形の紫外線吸収剤の熱的拡散を促進されるべき物品の表面層に直接に生じさせることが提案された。

この目的のために紫外線吸収剤を保護せられるべき物品に蒸着しこれを紫外線吸収剤の蒸着とその前述の物品の周囲への拡散を生じさせるために加熱する。

しかしながら、本発明者らは成る方法もなお若干の欠点を示すことを認めた。

したがつて、材料中に紫外線吸収剤の拡散を速くするに必要とする熱処理は、ある場合には処理される物品の機械的性質を劣化させる。

更に、この処理は比較的遅くかつ処理される物品の表面の仕上りを悪化する。この方法で処理された物品の表面の機械的性質より小さな表面の亀裂の存在が明らかになり、この亀裂は以後の非常に多くの亀裂の発生の原因となりかつそれにより処理される物品の信頼性を低下させる。

4

吸収剤の分布は本発明の方法により最適状態に達することができ、従つて同一形状の処理した紫外線吸収剤について、前述の周知の方法より効果的な保護を与える。

太陽光照射による劣化からプラスチック物品を保護することに関する本発明の方法においては、処理されるべき物品の表面は蒸気状態の紫外線吸収剤を含有する蒸気雰囲気中に供せられる。

蒸気状態の紫外線吸収剤を含有する蒸気雰囲気は例へば解理帯切に使用する紫外線吸収剤の性質に応じて100乃至200℃の範囲の範囲で加熱された紫外線吸収剤の液相により加熱された蒸気を導入することにより得られる。

理論的な処理の過程は紫外線吸収剤の液相と蒸気相との間の平衡を保ちそれにより紫外線吸収剤の蒸気で飽和した処理帯域で操作することにある。

しかしながら、処理環境における紫外線吸収剤の蒸気圧は余りに低く工業的な処理に適合し得る時間内に紫外線吸収剤の所望の被膜を与えることができない。ここでまた本発明者らは材料の表面

5

5

常に適用される紫外線吸収剤の濃度は処理帯域内の紫外線吸収剤の蒸気圧の直接的な函数であることを認めた。従つて処理帯域への蒸発により放散された蒸気の強制的消滅を生ぜしめ紫外線吸収剤の蒸気を含むする過飽和雰囲気中で操作することが可能である。

劣化に対して処理されるべき物品は其の形状または寸法により連続的にまたは不連続的に処理帯域に導入されかつ取り出され、勿論処理帯域からの紫外線吸収剤の逸散を避けかつ少くとも最少に減小させるため手段が講じられる。

本発明者らは紫外線吸収剤被覆の処理時間は処理されるべき物品の厚度がより高いときにはより短いことを認めた。従つて処理されるべき物品を其の形状や機械的性質を変えざる程度以上に上昇させないで予熱することが好ましい。

更に、本発明者らは物品の予熱温度は処理帯域の温度より高くあるべきでなくもしそうでないならば処理されるべき物品中に紫外線吸収剤が浸透する深さが所望の深さを除くことを認めた。

7

以下に本発明の実施例を示すが本発明はこれにより限定されるものではない。

実施例 1

ポリ塩化ビニルシートを4分間2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノンの蒸気で飽和された予熱気の作用に供する。該シートは88°Cで予熱する。

過飽和雰囲気は88°Cに自動温度調節された密閉された処理帯域に20.8°Cに加熱された紫外線吸収剤の蒸発により放散された蒸気を導入することにより得られる。

この処理時間を経過した後、シートは平方米あたり3.17の紫外線吸収剤で被覆され、この被覆はシート表面全体および表面層内に安定かつ均一に分布しておりその厚さは6乃至8ミクロンである。

かくして処理されたシートは長期間戸外で使用されたとき劣化に対し優秀な経年性を示す。

処理されたシートの機械的性質に対するこの処理の影響を示すため、衝撃-引張強度の試験を

8

一帯に処理されるべき物品を80乃至120°Cで予熱することが好ましいと思われる。

本発明により処理された物品上の現出された断面で行われた試験は紫外線吸収剤の被覆が均一に分布していることを示しかつ被覆は材料の表面層に集中しており被覆の厚さは該層の厚さに沿つた紫外線吸収剤の濃度の若干の変化により数ミクロン乃至数十ミクロンの範囲で変り得ることを示した。

本発明の方法は塩化ビニルホモポリマーおよび共重合体、アクリロニトリル-ブタジエンおよび/またはスチレン共重合体、ポリステレン、ポリカーボネート、ポリオレフィンなどのごとき多くの樹脂から製造された物品に適用する。この例は例示的に挙げたものでありこれに限定されるものではない。

同様に非常に多くの紫外線吸収剤を使用することができ、しかしながらその中でベンゾフェノンおよびベンゾトリアゾール誘導体が好ましいものである。

9

DIN 53448 スタンダード (刻みを付けない試験行) により行つた。衝撃-引張を383 m/secの速度で処理前および処理後に切り取られたシート試料に適用した。衝撃-引張強度は未処理シートについて68.8 kg/cm²、処理シートについては87.2 kg/cm²に増ししことを認めた。従つて本発明による紫外線吸収剤処理は処理された物品の機械的性質を変えないものと認められ、これは溶剤の使用を必要とする処理では得られないことである。

実施例 2

不透明な灰色のポリ塩化ビニルシートを実施例1のごとく処理した。

124の試験条件は次の通りである。

2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノンの溶液濃度 20.2°C

密閉した処理帯域の温度 88°C

シートの子板厚度 88°C

処理時間 8 分間

この処理帯域の処理後シートは平方米あたり

10

2.09の紫外線吸収剤で被覆され、この被覆はシート表面全体および18ミクロンの厚さを有する表面層上に安定かつ均一に分布される。

かくして得られたシートは太陽輻射線による光劣化に対して優秀な耐久性を示した。

実施例3

ポリ塩化ビニルシートを紫外線吸収剤として2-ヒドロキシ-4-オクトキシ-ベンゾフェノンを使用して実施例1で述べたごとく処理した。

得た試験条件は以下の通りであり、密閉した処理帯域へのシートの導入温度は室温である。

— 2-ヒドロキシ-4-オクトキシ-ベンゾフェノンの浴の温度 217℃

— 密閉した処理帯域の温度 110℃

— 処理時間 8分

この処理時間の経過後、シートは平方米あたり4.89の紫外線吸収剤で被覆され、この被覆はシート表面全体および30ミクロンの厚さの表面層上に安定かつ均一に分布する。

実施例4

試験条件は以下の通りである。

— 2-ヒドロキシ-4-メトキシ-ベンゾフェノンの浴の温度 200℃

— 密閉した処理帯域の温度 108℃

— シートの予熱の温度 97℃

— 処理時間 2分

この処理時間の経過後シートは平方米あたり4.69の紫外線吸収剤で被覆され、この被覆はシート表面全体および12ミクロンの厚さの表面層上に安定かつ均一に分布する。かくして処理されたポリカーボネートシートは光劣化に対し耐久性が良好である。

実施例5

ABB板を、2-ヒドロキシ-4-メトキシ-ベンゾフェノンを紫外線吸収剤として使用して、実施例1におけるごとく処理した。試験条件は以下の通りである。

— 2-ヒドロキシ-4-メトキシ-ベンゾフェノンの浴の温度 203℃

— 密閉した処理帯域の温度 103℃

13

ポリスチレンの不透明白色シートを、2-ヒドロキシ-4-メトキシ-ベンゾフェノンを紫外線吸収剤として使用して実施例1のごとく処理した。

試験条件は以下の通りであり、ポリスチレンシートは予熱しなかつた。

— 2-ヒドロキシ-4-メトキシ-ベンゾフェノンの浴の温度 203℃

— 密閉した処理帯域の温度 104℃

— 処理時間 60秒

この処理時間の経過後シートは平方米当たり3.89の紫外線吸収剤で被覆され、この被覆はシート表面全体および50ミクロンの厚さの表面層上に安定かつ均一に分布する。かくして処理されたポリスチレンシートは光劣化に対し耐久性が良好である。

実施例6

半透明のポリカーボネートシートを、2-ヒドロキシ-4-メトキシ-ベンゾフェノンを紫外線吸収剤として使用して実施例1におけるごとく処理した。

12

— 板の予熱温度 85℃

— 処理時間 60秒

この処理時間後、ABB板は1.79の紫外線吸収剤で被覆され、この被覆は板の表面および12ミクロンの厚さの表面層全体に安定かつ均一に分布する。これらの板は処理しない板より光劣化に対し明らかに耐久性が良好である。

実施例7

ポリプロピレン板を実施例1のごとく処理する。紫外線吸収剤はガイギー社から商品名チナグインP (TINOVIN P) として市販されているベンゾトリアゾール誘導体である。

試験条件は次の通りである。

— チナグインPの浴の温度 180℃

— 密閉した処理帯域の温度 92℃

— 板の予熱の温度 92℃

— 処理時間 8分

この処理時間後、板は平方米当たり3.79のチナグインPで被覆され、この被覆は板の表面全体および10ミクロンの厚さの表面層上に安定かつ均一

14

に分布している。かくして処理されたポリプロピレンは劣化に対し耐久性良好である。

本発明の実施の態様を要約すれば以下の通りである。

- (1) 処理すべき物品は50乃至120℃の温度で予熱する。
- (2) 蒸気状態の炭外種吸収剤を含む蒸気相を処理帯域に100乃至260℃の温度で加熱した炭外種吸収剤の溶液により分散される蒸気を導入する。
- (3) 処理帯域を炭外種吸収剤の蒸気により飽和する。
- (4) 処理帯域を炭外種吸収剤の蒸気により過飽和する。
- (5) 処理帯域を炭外種吸収剤の溶液の温度より低い温度に自動温度調節する。
- (6) 炭外種吸収剤をベンゾフェノンおよびベンゾトリアゾール誘導体からなる群から選んで行う。
- (7) 処理される物品は塩化ビニルホモポリマーおよび共重合体、ポリスチレン、アクリロニトリ

15

ループタジエンスチレン共重合体、ポリカーボネートおよびポリオレフィンからなる群から選ばれたプラスチック材料である。

代理人	金	丸	義	男
代理人	本	間	良	之
代理人	朝	内	忠	夫
代理人	八	木	田	茂
代理人	浜	野	孝	雄
代理人	森	田	哲	二

16

5. 添付書類の目録

- | | |
|------------|-----|
| (1) 明 細 書 | 1 通 |
| (2) 図 面 | 1 通 |
| (3) 委 任 状 | 1 通 |
| (4) 優先権証明書 | 1 通 |

6. 前記以外の発明者、代理人

- (1) 発 明 者

(2) 代 理 人

住 所 東京都港区西新橋1丁目2番9号
三井物産館内

氏 名	本	間	良	之
同 所	朝	内	忠	夫
同 所	八	木	田	茂
同 所	浜	野	孝	雄
同 所	森	田	哲	二